

**ДИФРАКЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ  
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ  
ОБЪЕМНЫХ НАЛОЖЕННЫХ ГОЛОГРАММ**

*B.B. Орлов*

Известно, что объемные наложенные голограммы, записанные двумя полными системами ортонормированных волновых полей, не содержат интермодуляционных решеток диэлектрической проницаемости, обусловленных интерференцией опорных и объектных волновых полей самих с собой [<sup>1</sup>]. Согласно модовой теории объемных голограмм [<sup>2</sup>], такие голограммы восстанавливают волновые поля без искажений и имеют 100%-ю дифракционную эффективность [<sup>3</sup>]. В настоящей работе исследованы объемные наложенные фазовые пропускающие голограммы, записанные взаимно ортонормированными опорными волновыми полями и произвольными объектными волновыми полями, не ограниченными условием их взаимной ортогональности. Ранее, в работе [<sup>4</sup>], были исследованы объемные наложенные голограммы, записанные объектными волновыми полями, почти ортогональными друг другу, т. е. волновыми полями, модуль скалярного произведения комплексных амплитуд которых намного меньше интенсивности волновых полей. В работе [<sup>4</sup>] перекрестные помехи рассматривались как результат дифракции на интермодуляционных решетках голограмм. В настоящей работе предполагается, что у голограмм отсутствуют интермодуляционные решетки диэлектрической проницаемости. Такие голограммы могут быть получены, если при их записи используется регистрирующая среда, не чувствительная к низким пространственным частотам интермодуляционной интерференционной картины, возникающей при регистрации голограмм. Нами рассмотрены перекрестные помехи, возникающие в результате дифракции на кросмодуляционных решетках голограмм, обусловленных интерференцией опорных и объектных волновых полей друг с другом. Отметим, что в работе не рассматриваются шумы, обусловленные дифракцией волновых полей на тех решетках, в записи которых они не участвовали. Данный вид шумов объемных наложенных голограмм рассмотрен в работе [<sup>5</sup>]. Им можно пренебречь, если углы между плоскими компонентами опорных и объектных волновых полей намного превышают угловую селективность голограмм.

Предположим, что с использованием  $K$  опорных и  $N - K$  объектных точечных источников, волновые поля которых в области записи голограмм представляют собой плоские волны, записывается  $M$  наложенных голограмм. Комплексные амплитуды опорных и объектных волновых полей можно представить в виде двух матриц

$$\hat{A} = (a_{mn}), \quad m = 1, \dots, M, \quad n = 1, \dots, K,$$

$$\hat{B} = (b_{mn}), \quad m = 1, \dots, M, \quad n = K + 1, \dots, N, \quad (1)$$

где матрица  $\hat{A}$  описывает опорные волны, матрица  $\hat{B}$  — объектные. Элемент матриц  $\hat{A}$  или  $\hat{B}$  с индексом  $mn$  описывает комплексную амплитуду  $n$ -й плоской волны во время записи  $m$ -й наложенной голограммы. Пусть опорные волновые поля ортонормированы

$$\sum_{I=1}^K a_{pI} a_{qI}^* = Q \delta_{pq}, \quad (2)$$

где  $\delta_{pq}$  — символ Кронекера,  $Q$  — интенсивность опорных волновых полей. Рассматривая полученную совокупность наложенных голограмм согласно модовой теории объемных голограмм [2], можно показать, что каждой из  $M$  наложенных голограмм соответствует две моды волновых полей голограммы  $\Lambda_{p(+)}$  и  $\Lambda_{p(-)}$  и два собственных числа  $\lambda_{p(+)}$  и  $\lambda_{p(-)}$ ,  $p = 1, \dots, M$  этих мод

$$\Lambda_{p(\pm)} = \sum_{g=1}^M (\pm a_{g1} \sqrt{\tau_p} Q^{-1}, \dots, \pm a_{gK} \sqrt{\tau_p} Q^{-1}, b_{g,K+1}, \dots, b_{gN}) r_g^p, \quad (3)$$

$$\lambda_{p(\pm)} = C \pm \sqrt{\tau_p},$$

где  $C$  — постоянная, зависящая от средней экспозиции регистрирующей среды. Как следует из (3), мода  $p$ -й наложенной голограммы имеет  $N$  компонент и представляет собой суперпозицию комплексных амплитуд опорных и объектных волновых полей всех наложенных голограмм. При этом коэффициенты, с которыми различные волновые поля входят в эту суперпозицию, определяются собственным вектором  $\mathbf{R}^p(r_1^p, \dots, r_M^p)$  и собственным числом  $\tau_p$  матрицы  $Q\hat{G}$

$$Q\hat{G}\mathbf{R}^p = \tau_p \mathbf{R}^p, \quad (4)$$

где  $\hat{G}$  — матрица Грама комплексных амплитуд объектных волновых полей

$$\begin{aligned}\hat{G} &= (g_{Ij}), \quad I, j = 1, \dots, M, \\ q_{Ij} &= \mathbf{B}_I \mathbf{B}_j^* = \sum_{n=k+1}^N b_{In} b_j^* j n\end{aligned}\tag{5}$$

и  $Q\hat{G}$  — матрица, равная произведению матрицы  $\hat{G}$  на интенсивность опорных пучков  $Q$ . Вектор  $\mathbf{B}_I(b_{I1}, \dots, b_{IN})$  в (5) определяется комплексными амплитудами объектного волнового поля  $I$ -й наложенной голограммы и представляет собой  $I$ -ю вектор-строку матрицы  $\hat{B}$  (1).

При восстановлении  $j$ -й наложенной голограммы в качестве граничного условия необходимо задать на первой поверхности голограммы опорное волновое поле этой голограммы  $\mathbf{A}_j(a_{j1}, \dots, a_{jK})$ , где  $\mathbf{A}_j$  представляет собой  $j$ -ю вектор-строку матрицы  $\hat{A}$  (1). Для этого сначала формируются волновые поля

$$\mathbf{L}_p = \frac{1}{2} (\Lambda_{p(+)} - \Lambda_{p(-)}), \tag{6}$$

содержащие компоненты только опорных волн. Опорное волновое поле  $j$ -й наложенной голограммы формируется в виде линейной комбинации

$$\mathbf{A}_j = \sum_{p=1}^M c_p \mathbf{L}_p, \tag{7}$$

где коэффициенты  $c_p$  находятся как решения системы  $M$  линейных уравнений

$$(\sqrt{\tau_1} r_q^1 c_1 + \sqrt{\tau_2} r_q^2 c_2 + \dots + \sqrt{\tau_M} r_q^M c_M) Q^{-1} = \delta_{qj}, \tag{8}$$

$$q = 1, \dots, M.$$

Рассмотрев в соответствии с модовой теорией объемных голограмм распространение суперпозиции мод (7) внутри голограмм, получим, что на расстоянии  $z$  от первой поверхности голограмм опорное  $\Psi_A(z)$  и объектное  $\Psi_B(z)$  волновые поля имеют вид

$$\begin{aligned}\Psi_A(z) &= \exp(IDCz) Q^{-1} \sum_{p,q}^M \cos(D\sqrt{\tau_p} z) \sqrt{\tau_p} r_g^p c_p \mathbf{A}_g, \\ \Psi_B(z) &= \exp(IDCz) \sum_{p,q}^M \sin(D\sqrt{\tau_p} z) r_g^p c_p \mathbf{B}_q,\end{aligned}\tag{9}$$

где  $D = \frac{k\kappa\sqrt{\varepsilon}t}{2}$ ,  $k$  — волновое число света в вакууме,  $\varepsilon$  — диэлектрическая проницаемость регистрирующей среды до экспонирования,  $\kappa$  — коэффициент пропорциональности между приращением диэлектрической проницаемости и величиной экспозиции,  $t$  — время записи каждой из наложенных голограмм, одинаковое для всех голограмм. Как следует из (9), при восстановлении наложенных голограмм опорным волновым полем  $j$ -й наложенной голограммы в общем случае восстанавливается не только волновое поле  $\mathbf{B}_j$ , данной наложенной голограммы, но и объектные волновые поля всех остальных наложенных голограмм. Их следует рассматривать как перекрестные помехи. Процесс восстановления чужих объектных волновых полей состоит в следующем. Если объектное волновое поле  $j$ -й наложенной голограммы  $\mathbf{B}_j$  не ортогонально объектному волновому полю  $I$ -й наложенной голограммы  $\mathbf{B}_I$ , то поле  $\mathbf{B}_j$  восстанавливает опорное волновое поле  $\mathbf{A}_I$   $I$ -й наложенной голограммы. В свою очередь опорное волновое поле  $\mathbf{A}_I$  восстанавливает соответствующее ему объектное волновое поле  $\mathbf{B}_I$ .

Рассмотрим два частных случая, в первом из которых перекрестные помехи полностью отсутствуют, а во втором они могут быть сделаны сколь угодно малыми. Пусть объектные волновые поля всех наложенных голограмм взаимно ортогональны  $\mathbf{B}_j \mathbf{B}_I^* = |B_j|^2 \delta_{jI}$ , тогда матрица Грама  $\hat{G}$  объектных волновых полей диагональна и собственные вектора  $\mathbb{R}^p(r_1^p, \dots, r_M^p)$  матрицы  $Q\hat{G}$  имеют отличной от нуля только одну свою компоненту. При этом, как следует из (9), восстанавливается объектное волновое поле только одной  $j$ -й наложенной голограммы и ее дифракционная эффективность может составлять 100%. В данном случае наложенные голограммы близки по своим свойствам к объемным наложенным голограммам, записанным двумя полными системами ортонормированных волновых полей, которые исследовались ранее теоретически [1,3] и экспериментально [6]. Рассматриваемые нами голограммы будут именно такими голограммами, если выполняются условия  $K = (N - K) = M$  и  $|B_j|^2 = |\mathbf{B}_I|^2$  при  $j \neq I$ .

Предположим теперь, что объектные волновые поля произвольны и дифракционная эффективность голограмм мала, что имеет место при их небольшой толщине  $z$

$$z \ll \frac{\Pi}{2D\sqrt{r_p}}, \quad p = 1, \dots, M. \quad (10)$$

Тогда в первом приближении восстанавливается объектное волновое поле только одной  $j$ -й наложенной голограммы. Действительно, в этом случае при разложении в (9)

$\sin(D\sqrt{\tau_p}z)$  в ряд  $\sin(D\sqrt{\tau_p}z) = D\sqrt{\tau_p}z - \frac{1}{6}(D\sqrt{\tau_p}z)^3 + \dots$  можно ограничиться лишь первым членом разложения. При этом все коэффициенты, с которыми различные объектные волновые поля входят в суперпозицию (9), согласно (8) равны нулю, кроме коэффициента при  $j$ -м волновом поле, равном  $QDz$ . Учет последующих членов разложения позволяет найти волновые поля перекрестных помех и сравнить их интенсивность с интенсивностью восстановленного волнового поля  $j$ -й наложенной голограммы.

Отметим, что при выводе соотношений (9) предполагалось, что объектные волновые поля всех наложенных голограмм линейно независимы, для чего необходимо выполнение условия  $M \leq N-K$ . На основе соотношений (9) могут быть рассчитаны дифракционные эффективности объемных наложенных голограмм и возникающие при их восстановлении перекрестные помехи в зависимости от параметров объектных волновых полей  $\tau_p$ ,  $R^p$ ,  $p = 1, \dots, M$ , зависящих от содержащейся в этих полях информации и от параметров  $z$ ,  $D$ , зависящих от характеристик регистрирующей среды и процесса ее экспонирования.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 95-02-03887-А), а также Международного научного фонда (грант MU-4000).

#### Список литературы

- [1] Орлов В.В. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. Вып. 2. С. 9-12.
- [2] Сидорович В.Г. // ЖТФ. 1976. Т. 46. Вып. 6. С. 1306-1312.
- [3] Орлов В.В. // ЖТФ. 1992. Т. 62. Вып. 8. С. 117-127.
- [4] Зельдович Я.Б., Шкунов В.В., Яковлева Т.В. // Проблемы оптической голографии. Л., 1981. С. 80-97.
- [5] Bashaw M.C., Heanue J.F., Aharoni A. et al. // JOSA B. 1994. V. 11. N 9. P. 1820-1836.
- [6] Орлов В.В., Булыгин А.Р. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. Вып. 1. С. 3-6.

Всероссийский научный центр  
"ГОИ" им. С.И. Вавилова"  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
10 мая 1995 г.